

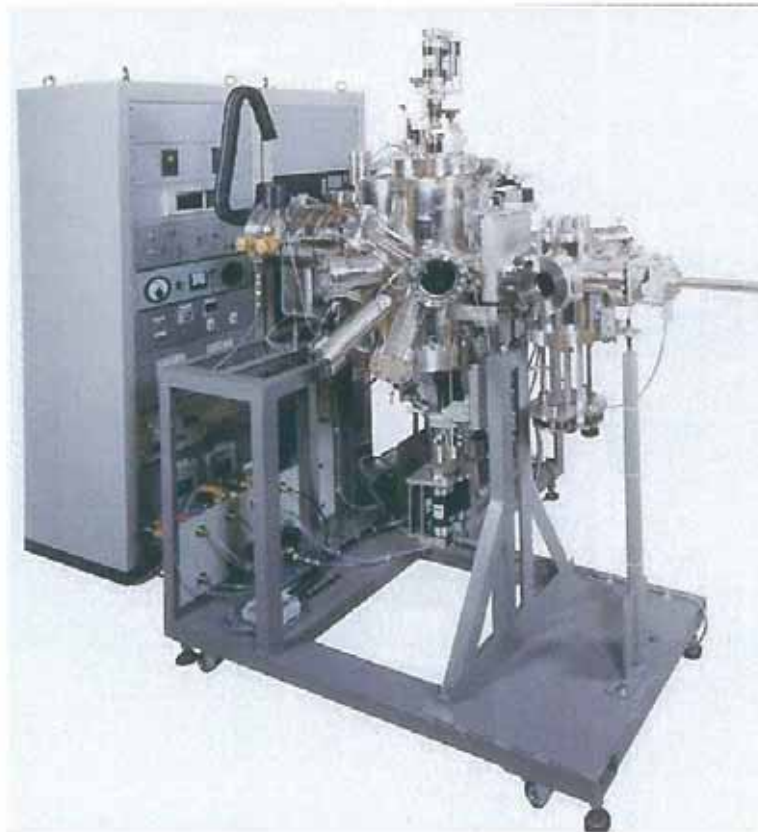
多次元同時マグネトロンスパッタ装置

(SPP-440S)

【概要】

本システムは、超高真空チャンバー内に最大4基のマグネトロンスパッタ源を配置し、成膜中基板を回転し、各スパッタ源を独立にシャッター制御する事により積層及び同時多元成膜を均一性よく行う事の出来るマグネトロンスパッタ装置です。

また、ロードロック室を装備する事により成膜中の不純物を減らす事が出来、高品質成膜も可能としました。



〔 S P P - 4 4 0 S 外 観 〕

【特長】

- 1 . スパッタ源の斜め配置に工夫を加え高均一性を実現しました。
- 2 . 成膜室を超高真空対応としたため、高品質膜を得る事が出来ます。
- 3 . 豊富なオプションにより幅広い成膜条件が得られます。

【主な仕様】

- 1 . 成膜室チャンバー： 外径 約 400mm
- 2 . 主ポンプ : 800 l/s 磁気浮上ターボ分子ポンプ
- 3 . 到達圧力 : 1×10^{-6} Pa(7.5×10^{-9} torr)
- 4 . スパッタ源: 2"マグネトロンスパッタ源 最大4基
シャッター内蔵 最大 300W
- 5 . 基板回転加熱機構: 基板 50mm×50mm 最大 温度 800
回転 20rpm 最大
- 6 . ロードロック室: 外径 約 200mm
- 7 . 主ポンプ : 50 l/s ターボ分子ポンプ
- 8 . 到達圧力 : 5×10^{-5} Pa(3.5×10^{-7} torr)
- 9 . 搬送 : 磁気カップリング移送機構 1枚 / 1回

【主なオプション】

- 1 . 基板冷却加熱回転機構(CHP-240R) - 20 ~ 400 対応
- 2 . 差動排気 RHEED システム(RHP-300S)
- 3 . 自動成膜コントロールシステム

P V R

真空機器技術コンサルティング

〒371-0032

群馬県前橋市若宮町4-26-2

TEL・FAX: 027-226-5491

E-mail: tetsuomaebashi@yahoo.co.jp